



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 893—2013

电子薄膜用高纯钛溅射靶材

High-purity sputtering titanium target used in electronic film

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位:有研亿金新材料股份有限公司、宁波江丰电子材料有限公司。

本标准主要起草人:何金江、董亭义、袁海军、罗俊锋、滕海涛、喻洁、贺昕、钱红兵、周辰、刘丹、陆灵芝、王学泽、熊晓东。

电子薄膜用高纯钛溅射靶材

1 范围

本标准规定了电子薄膜用高纯钛溅射靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明与合同(订单)等内容。

本标准适用于电子薄膜制造用的各类钛溅射靶材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值
 GB/T 4698.7 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定
 GB/T 4698.14 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定
 GB/T 4698.15 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定
 GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法
 GJB 1580A 变形金属超声检验方法
 YS/T 837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法
 YS/T 891 高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法
 YS/T 892 高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

靶材 target

在溅射沉积技术中的阴极部分。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在阳极表面沉积。

3.2

靶坯 target blank

阴极上用作溅射材料的部分。

3.3

背板 backing plate

用来支撑或固定靶材的部分。靶坯与背板可以通过焊接(如钎焊、扩散焊等)、机械复合、粘接等方式连接。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 产品按照结构形式分为单体和复合两种,示意图如图 1 所示。